CVD/エッチング/ALD装置対応プロセスガスモニタ Qulee RGM2-201F

半導体および電子部品市場は、激しい競争の中でますます微細化が進んでおり、近年、各種真空装置の歩留まり管理が重要視されています。しかしながら、これまでCVDやエッチングプロセスに関しては、腐食性の高いガス雰囲気に対する適切な対応が進んでおりませんでした。当社では、このような環境下でも使用可能な独自の磁石付きクローズドイオンソースを採用したRGA(プロセスガスモニタ)を開発し、長寿命化やフットプリントの縮小、メンテナンス性の向上を実現致しました。

是非とも、プロセスの管理を強化してみませんか?



日本真空工業会/JVIA表彰 2023年度 真空コンポーネント大賞受賞商品

Qulee RGM2-201Fの特徴



コンパクトサイズ

▲ 排気系・制御系一体型

👍 横置きでも縦置きでもOK

縦置き状態 240x350mm





ランニングコスト削減

メンテナンスが簡単

直交型ガス導入方式によりフィラ

メント交換が簡単(120分→約10分)

▲ フィラメント2本

二次電子増倍管を不採用

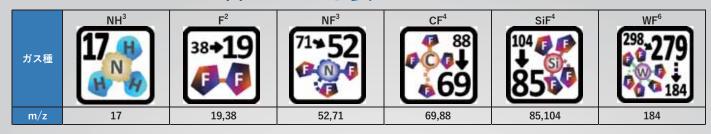


操作性の向上

オールPC制御+装置連動 タッチパネルにより現況確認が可能

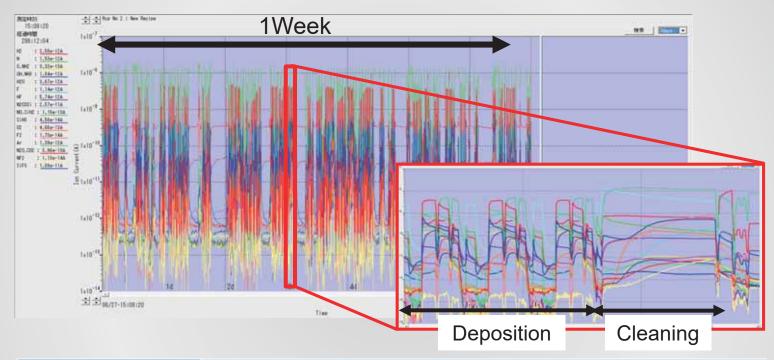
生産装置での安定稼働

CVD/エッチング/ALD装置で このようなガスを管理する必要はありませんか?



測定例

アルバック独自の磁石付きクローズドイオンソースの採用により、連続測定 においても安定した測定結果を得ることができます。



質量数範囲(amu)	1~200
測定圧力範囲	0.5~20Pa/10~500Paより選択
分解能(M/ΔM)	$M/\Delta M = 1M (10\%P.H.)$
検出器	ファラデーカップ
感度(A/Pa) ^{※1)※2)}	1e-5A/Pa (le=50uA)
最小検知分圧(Pa) ^{※1)}	e-10Pa台(EE50V、le500uA時)
全圧測定機能	あり
イオン源	磁石付きクローズドイオンソース
フィラメント	Ir/Y ₂ O ₃ 2本(うち1本は予備)
外形寸法(mm)	502×230×420(WDH)
フォアポンプ	なし(装置フォアポンプを使用)

※1) 予備フィラメントは適用外。
※2) 感度は使用ガス種・圧力・履歴によって変動。

株式会社アルバック コンポーネント事業本部 営業部 0467-89-2416

RGM2-201F 紹介ページ Youtube



